



Programme

Lundi 16 Novembre 2015. Lieu : Petit Salon Minatec, MMNT

Accueil entre 13:00 et 14 :00

14:00	14:15	Arnaud Mantoux (SIMAP)	Présentation générale, présentation de sponsors
-------	-------	---------------------------	---

Session tutorial, 14 :15- 17 :45, Chairman : Lionel Santinacci

14:15	15:00	Frédérique Donsanti (EDF R&D – IRDEP)	Historique et principes de base de l'ALD
-------	-------	--	--

15:00	15:45	Stéphane Danièle (IRCELyon)	Précurseurs pour l'ALD
-------	-------	--------------------------------	------------------------

15:45	16:15	Café	
-------	-------	------	--

16:15	17:00	Jacques Kools (Encapsulix)	Equipements d'ALD
-------	-------	-------------------------------	-------------------

17:00	17:45	Christophe Vallée (LTM)	Applications actuelles et émergentes de l'ALD
-------	-------	----------------------------	---

18:00	19 :30	Session Poster	
-------	--------	----------------	--

19 :30		Diner	
--------	--	-------	--

Mardi 17 Novembre 2015. Lieu : Petit Salon Minatec, MMNT**Session 1- 8 :30- 10 :30, Chairwoman : Frédérique Dosanti**

08 :30	08 :50	Raphaël Boichot (SIMAP)	Apport de la simulation en ALD : quand les outils numériques améliorent la compréhension et la conception des procédés.
08 :50	09:10	Alain Esteve (LAAS)	Atomic scale modeling in support of Atomic Layer Deposition experiments: application to high-k materials and energetic nanolaminates
09:10	09 :30	Michel Cassir (IRCP)	ALD pour les piles à combustible à oxyde solide : Etat de l'Art et perspectives
09 :30	09 :50	Patrik Hoffmann (EPFL)	Surface Kinetics of TiO ₂ Deposition using Titanium Tetraisopropoxide and Water
9 :50	10 :10	Fabien Piallat (Altatech)	Avantages du dépôt par Fast Atomic Sequential Technique (FAST) pour les dépôts de métaux avec une haute conformité.
10:10	10:30	Helen Grampeix (CEA Leti)	Effet de l'intercalation d'un pulse NH ₃ plasma sur les propriétés d'une silice PEALD préparée à partir de BDEAS
10:30	11:10	Café	

Session 2-11 :10- 12 :30 Chairman : Stéphane Danièle

11:10	11:30	Ioana Nuta (SIMAP)	La méthode d'effusion de Knudsen couplée à la spectrométrie de masse pour déterminer les propriétés thermiques des précurseurs ALD
11:30	11:50	Christophe Vallée (LTM)	Plasma ALD
11:50	12:10	Pierre Fayet (Tetrapak)	Propriétés mécaniques de couches minces déposées par PE-ALD sur des films de polymère
12:10	12:30	Evan Oudot (STMicroelectronics)	Passivation des photodétecteurs et des tranchées profondes d'isolation
12:30	14:30	Déjeuner dans le Grand Salon Minatec (photo de groupe)	

Session 3-14 :30- 16 :30, Chairman : Mickael Gros-Jean

14:30	14:50	Arturo Melendez Ceballos (IRCP)	ALD as a promising metal oxide deposition method for improving Molten Carbonate Fuel Cell components.
14:50	15:10	Mohamed Saadi (LTM)	Mémoires à pont conducteur (CBRAM) à base de HfO ₂ déposé par ALD
15:10	15:30	Maïssa Barr (CINaM)	Functionalization of TiO ₂ nanotubes for energy applications by Atomic Layer Deposition
15:30	15:50	Mikhael Bechelany (IEM)	Atomic layer deposition: from the design of functional nanomaterials to membranes applications
15:50	16:30	Aude Lefevre (CEA Leti)	HfO ₂ -Al ₂ O ₃ nanolaminate dielectric for ultra-high integrated MIM capacitors
16:30	16:50	Café	

Session 4- 16 :50- 18 :30 Chairman : Alain Esteve

16:50	17:10	Thibaut Cremel (Inst Néel)	ALD-built photonic wires from nanowire quantum dots
17:10	17:30	Stephan Cros (CEA Ines)	Ultra-high gas barrier measurements coupled with rapid control procedures
17:30	17:50	Stephan Cadot (CEA Leti)	Dépôt de couches 2D de MoS ₂ par ALD
17:50	18:10	Tariq Wakrim (LTM)	Structures Métal-Isolant-Métal à mémoire d'impédance élaborée par ALD
18 :10	18 :30	Jean-Luc Deschanvres (LMGP)	In-situ synchrotron analysis of the very first ALD growth steps of ZnO on a-SiO ₂ and c-plane Al ₂ O ₃ .
20:00	Dîner de la Conférence (Hôtel Europôle)		

Mercredi 18 Novembre 2015. Lieu : Campus Est, Phelma**Session 5- 9 :00- 10 :20, Chairman : Michel Cassir**

09:00	09:10	Alain Pasturel (CEMAM)	Labex CEMAM
09:10	09:20	Raphaël Boichot (SIMAP)	Plateforme ALD
09:20	09:40	Simon Elliott (Tyndall Institut)	National COST HERALD
09:40	10:00	Tony Maindron (CEA Leti)	Les Diodes Electroluminescentes Organiques: Encapsulation par Couches Barrières et Applications dans les écrans miniatures et l'éclairage
10:00	10:20	Nathanaelle Schneider (IRDEP)	L'ALD pour la cellule solaire CIGS
10:20	10:40	Café	

Session 6- 10 :40- 11 :50, Chairman : François Neully ou Perrine Carroy

10:40	11:10	Mickael Gros-Jean (ST Microelectronics)	L'ALD en microélectronique : Applications, équipements et productivité
11 :10	11 :30	David Muñoz-Rojas (LMGP)	Fast and scalable thin film deposition, doping and surface engineering using Atmospheric Pressure Spatial ALD (AP-SALD): application to new generation PV
11 :30	11 :50	Mikko Söderlund (Beneq)	Large-area ALD from batch to spatial
11 :50	12 :00	Remis de prix à la meilleure présentation poster et à la meilleure présentation orale	
12 :00	12:30	Visite de la plateforme ALD de CEMAM (inscription)	
12:30	14:00	Déjeuner	

14:00 16:00 Construction du réseau RAFALD (Elisabeth BLANQUET)

16:30 17:00 Visite de la plateforme ALD de CEMAM (inscription)

Posters : Lundi 16 Novembre, Grand Salon Minatec

P1	Jorge Mario Herrera Morales (CEA)	ALD films for corrosion protection of medical micro devices
P2	Catherine Marichy (LMI)	Elaboration par ALD et caractérisation d'hétérostructures ZnO/GaN
P3	Corina Barbos (INL)	Caractérisation de couches d'Al ₂ O ₃ déposées par ALD thermique pour des applications photovoltaïques
P4	François Montaigne (IJL)	Connecting ALD with Ultra High Vacuum techniques, the TUBE Davm project
P5	Lorraine Duclaux (IRDEP)	Etude de l'insertion de l'aluminium dans une matrice Cu ₂ -xS par ALD pour réalisation d'électrode conductrice et transparente de type p
P6	Mathieu Benz (SIMAP)	Aluminum nitride thin films deposited by plasma enhanced atomic layer deposition
P7	Perrine Carroy (INES)	Interest of plasma-enhanced atomic layer deposition for the deposition of the transparent electrodes of silicon heterojunction solar cells
P8	Christophe Defranoux (Semilab)	Spectroscopic Ellipsometry as a method for process characterization and monitoring of ALD OLED encapsulation
P9	Romain Parize (LMGP)	Multiple Roles of HMTA in the Formation Mechanisms of ZnO / TiO ₂ Core Shell Nanowire Arrays by Chemical Bath and Atomic Layer Depositions
P10	Rémy Gassilloud (CEA Leti)	Study of Hydrogen plasma reduction of Nickel substrate during PEALD Ta ₂ O ₅ deposition for ReRAM application
P11	Nohora Caicedo (LIST)	Horizontally aligned top-down ZnO nanowires for sensing applications through ALD deposition
P12	N. Adjeroud (LIST)	Atomic Layer Deposition of Metalcone